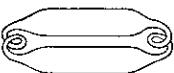


лируемых процессов перезамыкания магн. силовых линий при отклонении профиля $q(V)$ от оптимального, соответствующего минимуму энергии системы. В токамаке предельное β может превышать 5%, в пинче с обращенным полем — в неск. раз выше. В стеллараторных системах расчётное значение β может достигать

Рис. 8. Магнитная ловушка «дракон» — комбинация ловушки с пробочной геометрией и тороидальной системы.



10%. Имеется возможность его увеличить введением прямолинейных участков с пониженным магн. полем при спец. выборе замыкающих элементов, не допускающих перекатывание вторичных токов на прямые участки (система «дракон», рис. 8).

Лит.: А р ц и м о в и ч Л. А., Замкнутые плазменные конфигурации, М., 1969; Л у к ъ я н о в С. Ю., Горячая плазма и управляемый ядерный синтез, М., 1975; В о л к о в Е. Д., С у п р у н е н к о В. А., Ш и ш к и н А. А., Степларатор, К., 1983. В. Д. Шафранов.

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — вещества, обладающие при темп-рах ниже темп-ры магн. упорядочения самопроизвольной намагниченностью, обусловленной параллельной ориентацией атомных магн. моментов (**ферромагнетики**) при темп-ре ниже *Кюри точки* T_C или антипараллельной ориентации различных по величине суммарных моментов **магнитных подрешёток** (**ферримагнетики** при темп-рах ниже *Нееля точки* T_N). Вид магн. упорядочения и значения T_C и T_N определяются знаком и величиной обмениного интеграла (см. *Обменное взаимодействие*). Представителями ферромагнетиков являются Fe, Co, Ni, Gd, Dy и нек-рые др. редкоземельные металлы (РЗМ), а также их сплавы и соединения; нек-рые сплавы и соединения Mn, Cr, U. К типичным представителям ферримагнетиков относятся **ферриты** — двойные оксиды переходных металлов со структурой шпинели (NiFe_2O_4 и др.), со структурой граната ($\text{Gd}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ и др.), с гексагональной структурой ($\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ и др.). К ним же принадлежат известный с древнейших времён магнетит Fe_3O_4 , а также нек-рые сплавы, напр. GdFe_2 , MnGe_2 .

К осн. характеристикам М. м. относятся: T_C , T_N , намагниченность насыщения M_s , магнитокристаллографич. анизотропия (константы K_1 и K_2), **магнитострикция** λ_s . Эти свойства в основном определяются хим. составом М. м. Др. свойства — кривая намагничивания $M(H)$, козэрцитивная сила H_c , магнитная проницаемость μ , остаточная намагниченность M_r — существенно зависят от **магнитной атомной структуры**, в частности от её дефектности. По характеру кристаллич. структуры осн. часть М. м. является поликристаллами; применяют М. м. в виде монокристаллов и **магнитных пленок**; всё шире используют **аморфные магнетики**. Существуют также **магнитные жидкости**, создаваемые путём коллоидного диспергирования оченьмелких частиц М. м.

По комплексу магн. свойств М. м. подразделяются на **магнитно-мягкие материалы** и **магнитно-твёрдые материалы**. Для первых характерны малая величина H_c и большая μ , для вторых — большие значения H_c и M_r . Специфика применения М. м. в технике определяется общей совокупностью их свойств. В этой связи из осн. групп М. м. выделяют **магнитострикционные материалы**, термомагнитные материалы, М. м. для СВЧ, магн. материалы с **цилиндрическими магнитными доменами**, пленки с большой плотностью записи информации и др. Области применения М. м. чрезвычайно разнообразны. Осн. масса их используется в электротехнике — трансформаторные и динамические стани для магнитопроводов в трансформаторах, электрогенераторах и моторах, дросселях и накопителях. Детали из М. м. используются при создании сильных и компактных источников постоянного магн. поля, миниатюрных электромоторов, в аппаратуре связи, радиолокации, магн. записи, вычислите. технике и др.

Лит.: В о н с о в с к и й С. В., Магнетизм, М., 1971; М и ш и н Д. Д., Магнитные материалы, М., 1981; Пресионные сплавы. Справочник, под ред. Б. В. Молотилова, 2 изд., М., 1983.

А. Ф. Прошкин.

МАГНИТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ УРОВНИ — квантовые энергетич. уровни электронов проводимости, движущихся в проводнике вблизи его поверхности под действием параллельного ей постоянного магн. поля. Для возникновения М. п. у. необходимы: большая длина свободного пробега электронов и большая вероятность их зеркального отражения при столкновении с поверхностью проводника. Выполнение этих условий достигается при гелиевых темп-рах (4,2 К) в очень чистых монокристаллах проводников, имеющих оптически гладкую поверхность.

Квазиклассич. картина явления состоит в следующем. М. п. у. возникают в проводнике для электронов, фермиевская скорость v_F к-рых почти параллельна поверхности образца. В пространстве импульсов эти



Рис. 1. а — траектория электрона, «скакующего» внутри проводника по его поверхности под действием силы Лоренца, создаваемой магнитным полем; б — траектория «скакующего» электрона в импульсном пространстве; показано сечение поверхности Ферми плоскостью рисунка; О — опорная точка.

электроны находятся на **ферми-поверхности** в малой окрестности её т. н. опорной точки O , в к-рой v_F точно параллельна поверхности образца. Магн. поле, воздействуя на электроны этой группы силой Лоренца, удерживает их у поверхности образца. В этих условиях электроны движутся по дугам малой кривизны, возвращаясь к поверхности образца и зеркально отражаясь от неё. Тем самым электроны совершают периодич. движение (электроны «скакут» по поверхности, рис. 1, а), к-рое должно быть квантовано. Разрешёнными оказываются орбиты, для к-рых магн. поток через сегмент, образуемый дугой траектории и поверхностью образца, равен

$$F = (n + \frac{1}{4}) \cdot ch/e, \quad (1)$$

где $n = 1, 2, \dots$, e — элементарный заряд. В импульсном пространстве движению по скакующим орбитам соответствует движение по замкнутой орбите на поверхности Ферми в малой окрестности точки O (рис. 1, б), к-рос квантуется.

Квантовое рассмотрение движения электронов приводит к выражению для значений магн. поля H_{nk} , при к-рых имеют место максимумы резонансного поглощения эл.-магн. поля частоты v :

$$H_{nk} = \frac{4V\sqrt{2h}c}{3e} \cdot v^{3/2} \left(\frac{R}{v^3} \right)^{1/2} (n^{2/3} - k^{2/3})^{-3/2}. \quad (2)$$

Здесь $n, k = 1, 2, 3, \dots$; $n_1 = n + \frac{1}{4}$; $k_1 = k + \frac{1}{4}$; R — радиус кривизны орбиты электронов в точке O .

Экспериментально существование М. п. у. обнаруживается как осцилляции (с амплитудой $\leq 0,1\%$) полного поверхностного сопротивления проводника ($v \sim 10-100$ ГГц) в зависимости от магн. поля, изменяющегося в пределах $0,1-100$ Э (рис. 2). М. п. у. изучались на монокристаллах Sn, Bi, In, Cd, Al, Cu [1, 2]. Природа осцилляций аналогична эффекту де Гааза — ван Альфена (см. *Квантовые осцилляции в магнитном поле*). Вычисленные по ф-ле (2) и по известным параметрам поверхности Ферми Bi значения H_{nk} точно совпадают с измеренными максимумами реактивного поверхностного сопротивления образца Bi [3-5].